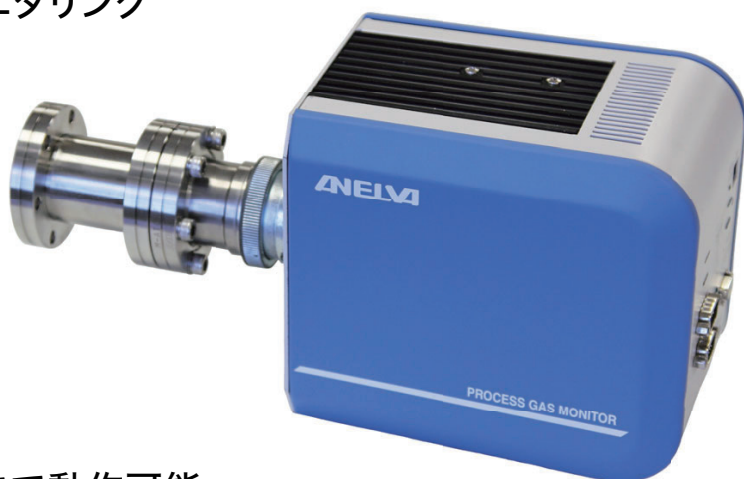


スパッタリングプロセス中のガスモニタリングと 残留ガス分析の両立

超高真空とスパッタリングプロセス中の圧力領域を同一計測器で測定可能です。スパッタリング中のガスを監視できるため、ガス異常・リーク等の不具合を検知し、プロセス異常による製品不良を未然に防ぐことができます。

M-080QA-HPM

- 1 スパッタリング成膜プロセス中のモニタリング
- 2 残留ガス分析
- 3 リークチェック

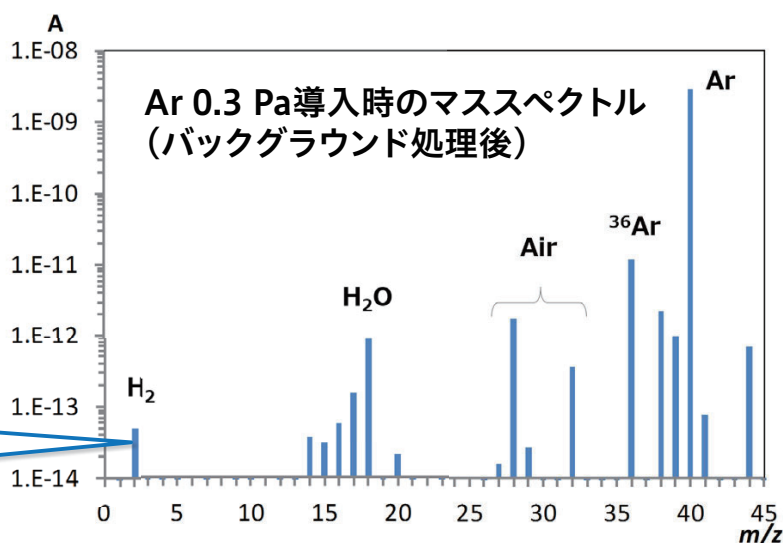


▶▶ 特長

- 1 差動排気系なしで 高真空から 2 Paまで動作可能
- 2 プロセス中の水素を高感度で検出
- 3 フィラメント寿命が長く低TCO
- 4 特別仕様により酸化膜プロセスにも対応

▶▶ 測定例

水素を高感度で
検出可能



高解像度で高速撮影を可能にするX線源

透過密閉型X線管を搭載したマイクロフォーカスX線源です。安定した出力で高解像度・高速撮影を可能にする性能を有し、X線CT/透視撮影に幅広く対応します。

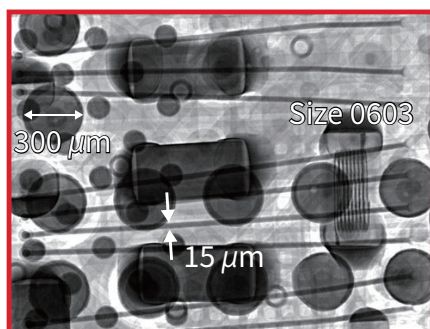
G-311/511 シリーズ

- 1 ターゲットメンテナンスフリー、長期保管が可能
- 2 X線管寿命の自己診断機能
- 3 半導体・電子部品の解析に幅広く対応
- 4 用途に合わせ最適なX線源をご提供いたします
 - 高出力 G-311VH-D … 高速撮影
 - 高分解能 G-511VL-D … 分析用途

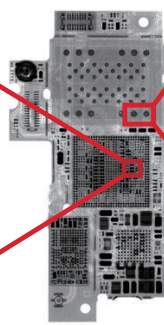


▶▶ 撮影画像例

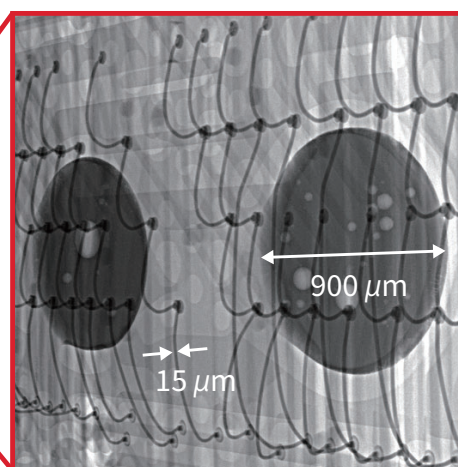
音楽プレーヤー用 PCB



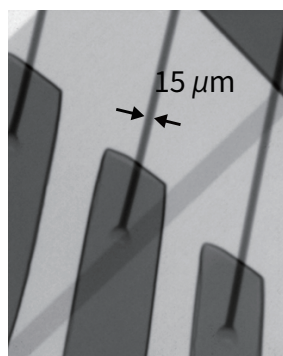
60×



2.5×

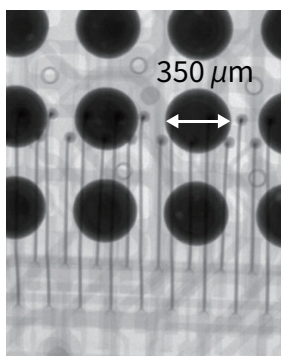


ワイヤー



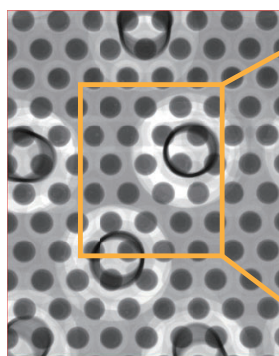
300×

BGA

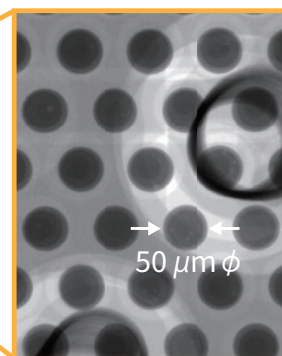


120×

CPU : C4 バンプ (50 μm φ)



70×



112×